

スプレーギクにおける合理的な養分管理法

[研究のねらい]

近年、全国的にキクやカーネーションを中心に養液土耕栽培（栽培期間を通して液肥のみで施肥を行うため土耕栽培）が普及しつつあり、県内でもスプレーギクにおいて導入事例がみられます。そこで、スプレーギクの養液土耕栽培における合理的な養分管理法について明らかにします。

[研究の成果]

- ①県内スプレーギクの出荷規格に基づく 2L 級の切り花（切り花長 80 cm、切り花調整重 40 g 以上）を生産するために最低必要な窒素量は、冬季で 350 mg/切り花 1 本、夏季で 270 mg/切り花 1 本でした（図 1）。
- ②総施肥量が同じであれば、その分配の方法が異なっても同じ品質の切り花ができあがることから、栽培期間を通して総施肥量を等分割して与えることで簡易に施肥できます。
- ③施肥間隔が 10 日を超えると葉が小さくなるなど生育（特に初期）がやや劣るため（図 2）、7 日間隔以下で施肥を行います。
- ④定植直後には養分による高濃度障害を受けやすいため（写真 1）、土壌溶液中の硝酸態窒素濃度を 50~300 ppm に維持するよう心がけます。

[成果の活用面・留意点]

- ①培地中の養分レベルの適性維持によりスプレーギクの安定生産につながります。
- ②本成果は、ベンチ栽培におけるデータに基づきます。

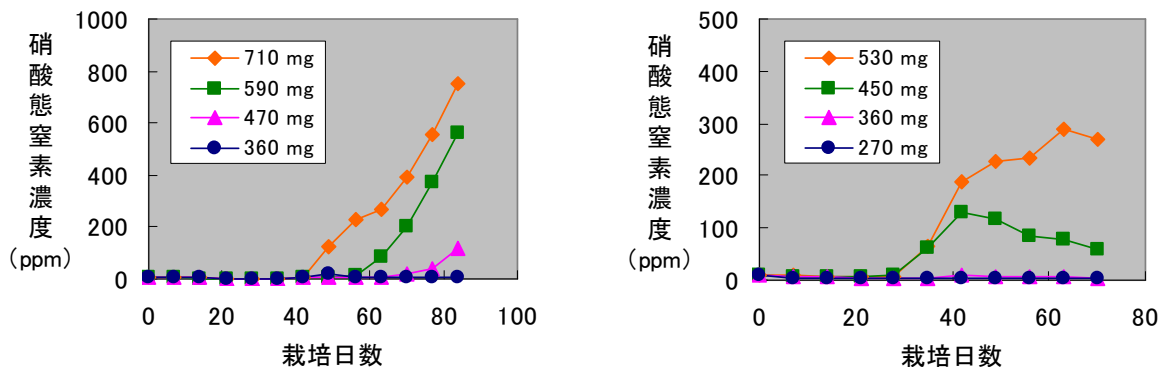


図1 総施肥量と土壌溶液中の硝酸態窒素濃度(左図:冬季、右図:夏季)

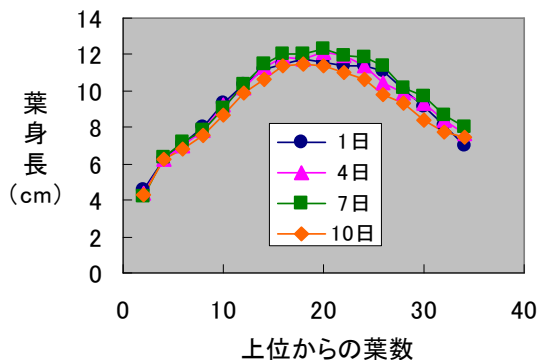


図2 施肥間隔と葉身長



写真1 多肥による高濃度障害

実施年度：平成 12~14 年度
担当者：島 浩二